トピックス

NEXAFS による窒化炭素薄膜の局所構造解析

下山巖

日本原子力研究所*

Local Structures Analysis of Carbon Nitride Films by Utilizing NEXAFS Spectroscopy

Iwao SHIMOYAMA

Japan Atomic Energy Research Institute

Nar edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS) was used to investigate the local structures in carbon nitride (CN_x) films synthesized by ion implantation method. The N 1s NEXAFS spectra of CN_x film have shown three sharp π^* and one broad σ^* resonances whose intensities have clear polarization dependence. The polarization dependencies of the first and third π^* resonances have given similar tendency to that of the π^* resonance of graphite. While, the second π^* resonance has given different behavior. From the results, we concluded that the first, second, and third π^* resonances originate from pyridine-like structure, cyanic structure, and graphite-like structure, respectively. The results show the clear experimental evidence that there exists a graphite-like structure in which some of the carbon atoms are substituted by nitrogen atoms.

1. はじめに

まだ読んではいないが窒化炭素を題材にした SF 小説¹⁾ があるらしい。女子高生が偶然「空気よりも軽くダイヤモ ンドよりも硬い」窒化炭素を合成してしまい、会社を作っ て大儲けというなんだかあやかりたいような設定だが、窒 化炭素という物質は一般にも次第に知られつつあるのかも しれない。それまでジシアンという猛毒のガスしか知られ ていなかった窒化炭素化合物 (CN_x) に対して, 安定な固 体が形成される可能性を初めて指摘したのは, Liu と Cohen²⁾である。彼らの報告した β -C₃N₄相はダイヤモン ドに匹敵する体積弾性率が予想されたため新たなコーティ ング材料として一気に注目をあびるようになった。このβ -C₃N₄は sp³の炭素と sp²の窒素から構成された六方晶で あり,窒化珪素 β-Si₃N₄ と同じ構造をとるが,これ以外に も様々な結晶構造が提案されている。ダイヤモンドより硬 いと考えられているのは sp³の炭素と窒素から構成された 珪亜鉛鉱構造の立方晶 c-C₃N₄ であり, Teter と Hemley³⁾ の第一原理計算によればその体積弾性率は496 GPa とダ イヤモンドの実験値443 GPa⁴⁾よりも大きい。これが「ダ イヤモンドよりも硬い」イメージにつながったのだろう。 同じ立方晶ではダイヤモンド類似化合物とでも言うべき閃 亜鉛鉱構造の擬立方晶(pseudocubic-)C₃N₄³⁾も提案され ているが、これは炭素のサイトでところどころ空孔のある 構造のため珪亜鉛鉱構造よりは少し柔らかいようだ。六方

晶では β-C₃N₄ のレイヤーがその鏡像層と AB スタッキン グ構造をとる α -C₃N₄相があり、これは sp³の炭素と sp² の窒素から構成される³⁾。また他には sp²の炭素と窒素か らできるグラファイト C₃N₄ がある³⁾。これは炭素のサイ トで空孔のあるグラファイト類似化合物といえよう。Anders と Snis⁵⁾はこのようなグラファイト型 CN_xの電子構 造を計算し、C11N4の組成では金属的であるのに対し、C3 N4の組成においては約1.1 eV とシリコン並みのバンドギ ャップを持つ半導体になることを報告している。よってこ のグラファイト型 CN_x は原子一層の厚さしか持たない半 導体材料として興味深い。さらに Santos と Alvalez⁶⁾はグ ラファイトの炭素を窒素で置換していくと平面構造が次第 に歪んで CN ナノチューブやフラーレンのようなかご型分 子(C₂₄N₃₂)になっていく可能性を指摘しており、この報 告は CN_x がナノデバイスとしても興味深い材料であるこ とを示している。また、そのほかにも菱面体晶 CN7)や、6 員環と5員環からなる架橋構造8)も提案されている。

このように興味深い性質を期待されている CN_x 材料を 合成しようという試みは Liu と Cohen の指摘以来10年以 上にわたって積極的に行われている。合成にはイオンビー ム堆積法⁹⁾やマグネトロンスパッタリング¹⁰⁾などの非平衡 反応による方法が用いられ,これらの方法は固溶限界を超 えた窒素濃度をもつ材料合成に有力である。しかし現状の ところ,理論的に予測されている CN_xの多くはその存在

^{*} 日本原子力研究所 放射光科学研究センター 表面化学研究グループ 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4 TEL: 029-282-6823 FAX: 029-282-5832 E-mail: shim@popsvr.tokai.jaeri.go.jp

を実証する段階からまだ抜けきってはいない。合成された 材料の殆どは非化学量論的なアモルファスであり、長距離 構造が無いだけでなく幾つかの異なる局所構造が含まれた 複雑な系であるため構造決定を非常に困難にしてきた。 β -C₃N₄ あるいは c-C₃N₄ の合成に成功したといういくつ かの報告もなされているが¹¹⁻¹³⁾、その大きさはナノス ケールの徴粒子であり、CN_x 薄膜中の構造にはまだ不明 な点が多い。

このような現状ではまず局所構造を明らかにすることが 先決であり,X線光電子分光法(XPS)はこの目的で最 も広く用いられている。内殻準位は結合には関与しないも のの,周囲の局所的な化学的環境によってその結合エネル ギーをシフトさせる(化学シフト)ため,何らかの標準と 比較することにより,価数やイオン結合性についての知見 を得ることができる。しかし化学シフトは間接的な情報で あるため,その解釈にはある程度のあいまいさがつきまと う。CN_xの場合,後述するように XPS スペクトルの解釈 には多くの提案がなされ,現在もなお議論が続いている。

一方, 吸収端近傍 X 線吸収微細構造 (NEXAFS) は XPS 同様、局所構造解析に有力な手法であるが、放射光実験と いうバリアーの高さのためか XPS ほど用いられてこなか った。NEXAFS は内殻から特定の空軌道への遷移に起因 するものであり, 空軌道を直接プローブするため局所的な 化学状態を反映する。さらに放射光の偏光特性から軌道成 分を分離して観測することができるため、局所構造の立体 配置や配向に関する情報を直接得ることが可能である。こ れは XPS に無い大きな利点といえよう。そこで我々は NEXAFS とイオン注入法の組み合わせに注目した。CN_x 合成においてイオン注入法はイオンビームスパッタリング 法やrf スパッタリング法などと比べると生成物の窒素濃 度が低く、C₃N₄のように高窒素含有量が必要な材料合成 には不利な面があるため少々マイナーな観は否めないが、 入射イオンのエネルギーにより深さ方向に濃度傾斜をつけ ることや、出発物質を選択することで、ある程度生成物を 制御することも可能であるため依然として興味深い手法と いえよう。特にグラファイトを出発物質とした場合、その 2次元的な配向により,NEXAFS が顕著な偏光依存性を 示すことが期待されるので、他の合成方法にはない大きな 利点がある。本稿では NEXAFS を用いた CN_x 薄膜中の 局所構造の研究を紹介し、新物質の構造解析における NEXAFS の有用性について論じる。

2. 実験

実験は高エネルギー加速器研究機構放射光施設(KEK-PF)のBL-11Aと27Aで行った。イオン注入のターゲットには c 軸の揃った Highly Oriented Pyrolitic Graphite (HOPG)を用いた。HOPG は大気中で清浄表面を出した 後真空チェンバー内に導入し、 $\sim 10^{-7}$ Pa で700~800°C, 3 分間の加熱を行った後イオン注入を行った。CN_x 薄膜は 1 keV もしくは 3 keV の低エネルギー N_2^+ イオンを HOPG に対し直入射し,そのときのイオンフラックスの 典型値は 1×10^{13} atoms/s•cm² であった。また照射時間を 変えることにより $10^{15} \sim 10^{17}$ atoms/cm² の範囲でフルエン スを制御した。

XPS の測定は BL-27A において行った。H や O などの 不純物の影響を避けるため XPS 測定は上記のように合成 した試料について in situ で行った。光源として hv = 1.8keV の単色軟 X 線を用い, Tanuma, Powell, Pennの式¹⁴⁾ から見積もったこのときの C1s, N1s 光電子の平均自由行 程はそれぞれ約4.0, 3.7 nm である。試料中の窒素濃度 は、半球型アナライザーを用いて得られたスペクトルの N1s, C1s 光電子ピークの強度比と hv=1.8 keV のフォト ンの吸収断面積,及び平均自由行程から求めた。また,比 較のために Fig.1 にしめす標準物質についても XPS スペ クトルを測定した。このうち pyridine(参照データ¹⁵⁾)と triazine $\oplus \mathcal{O}$ N $\bowtie sp^2$, triethylamine \succeq hexamethylenetetramine 中のNは sp^3 とそれぞれ異なる立体配置をとる。 XPS 測定において triazine, triethylamine は Cu(100)上の 凝縮系を用い, hexamethylenetetramine は粉末試料を用 いて測定を行った。

NEXAFS 実験は BL-11A で行った。NEXAFS 実験に ついても同様に *in situ* で測定を行い,試料電流法を用い てスペクトルを得た。N K 端の NEXAFS スペクトルにつ いてはイオン注入前の HOPG のバックグラウンドスペク トルとの差を取ることによって求めた。また試料の法線 方向と電場ベクトルとのなす角で定義される入射角 *θ* を 10°(斜入射) から90°(直入射) まで変えながら NEXAFS



Figure 1. Standard materials having C–N bonds. Nitrogen atoms in (a): triethylamine (TEA) and (c): hexamethylenetetramine (HMTA) have sp^3 configuration. Nitrogen atoms in (b): triazine (TA) and (d): pyridine have sp^2 configuration.

の偏光依存性を測定した。ところでイオン注入法では、必 ずイオン照射による損傷が生じるためフルエンスが増すと 共に次第にグラファイトの配向性が失われる。そこで NEXAFS スペクトルの偏光依存性に関する測定は~10¹⁵ atoms/cm² の低フルエンスでの試料について行った。さ らに構造変化を調べるため200~1000℃まで温度を変えな がらアニールを行い、それぞれの温度に対し3分間のア ニール後 NEXAFS スペクトルを測定した。

3. CN_x 薄膜の局所構造

3.1 XPS による解釈

まず, XPS からどのようなことがわかるかをみてみよ う。**Figure 2** に [N]/[C] = 0.23の CN_x 薄膜の N1s XPS スペクトルを示す。Gaussian (点線) で示したように 3 つの明瞭な成分 P₁ (E_B =398.3 eV), P₂ (E_B =400.3 eV), P₃ (E_B =402 eV)が観測された。この結果からまず薄膜中 に異なる化学状態にある N サイトが複数存在することが わかるが、実は他の方法で合成された CN_x の XPS スペク トルにも同様のピーク成分が観測されている。合成方法に よらない共通のピークはユニバーサルな窒素の局所構造の



Figure 2. N 1s XPS spectrum of the CN_x film for [N]/[C] ratio of 0.23. Solid and broken lines show the experimental result and Gaussian functions which are used for peak fitting, respectively. The peak energies of P₁, P₂, and P₃ are 398.3, 400.3, and 402.6 eV, respectively. Vertical lines show the N 1s binding energies of reference materials.

存在を示唆しているが、これらのピークに対してこれまで Table 1 に示したように様々な解釈が提案されてきた。こ

Table 1. The peak energies of N 1s XPS spectra of CN_x films prepared by various kinds of synthesis methods. The assignments for the peak components are also listed in the table

	Synthesis Method	Peak Energies in N 1s XPS Spectra (eV)	Assignment
Marton <i>et al.</i> ²⁸⁾	ion beam deposition	398.3	<i>sp</i> ³ bonded N
		400.0	<i>sp</i> ² bonded N
		402.0	N ₂ or NO
		398.1	tetrahedral N (<i>sp</i> ³)
Sjöström et al. ⁸⁾	dc magnetron sputtering	400.0 ~402	Graphite-like hexagonal N (<i>sp</i> ²) not N–O
		398~398.3	<i>sp</i> ³ bonded N
Zheng et al. ²⁷⁾	dc magnetron sputtering	398.9	nitrile group $(-C \equiv N)$
		400.0~400.7	sp^2 bonded N
		\sim 402	NO
Ronning et al. ²⁹⁾	ion beam deposition	\sim 398	three-carbon coordinated N
		\sim 400	two-carbon coordinated N
Holloway <i>et al.</i> ³⁰⁾	dc magnetron sputtering	~398.5	three-carbon coordinated N
		${\sim}401$	four-carbon coordinated N
Galán et al. ³¹⁾	ion implantation	398.7	nitrile group $(-C \equiv N)$
		399.7	metastable
		400.7	imine type $(>C=N-)$
		402.4	N_2
Quirós <i>et al.</i> ³²⁾	dual ion beam sputtering	399.3	nitrile group $(-\!C\!\equiv\!N)$ and
		401.3	graphite-like structure
		403.6	N ₂ or NO
		405.9	
Kim <i>et al.</i> ³³⁾	plasma enhanced CVD	398.3	NHy
		400.2	CN _x
		402.2	NO

のうち N-O あるいは N-H への帰属は *in situ* で測定した 我々の XPS スペクトルにも同様のピークが観測されるこ とから除外することができるが、主な成分である P1, P2 が立体配置の違いに起因するものか、配位数の違いによる ものかが大きな問題である。これに対し我々は標準試料と の比較を行い, Fig. 2 に示すように全ての標準物質の結 合エネルギー E_B が近い値を持ち、 P_2 のエネルギー領域に 偏っていることを明らかにした。Siegbahnのモデル¹⁶⁾に 従って C=N2 重結合を 2 本の C-N 結合と勘定すると、こ こで用いた標準試料中の全てのNは3つのC-N結合を持 つことになり、これを反映して Fig. 2 の結果が得られた と考えられる¹⁷⁾。このことから少なくとも Table 1 の帰 属のうち sp³, sp² や tetrahedral, hexagonal などの立体配 置によるものを除外できるが、我々の結果では $P_1 \diamond P_3$ に対応する標準試料がなく、これらのピークがどのような 局所構造に起因したものなのか依然不透明なままである。 そこで次に NEXAFS を用いて調べてみることにしよう。

3.2 NEXAFS による解釈

Figure 3(a)に3.4×10¹⁵ atoms/cm²の低フルエンスで 合成した CN_x 薄膜([N]/[C]≤5%)の窒素 K 吸収端 (N1s) NEXAFS スペクトルの偏光依存性を示す。hv= 398.3, 399.5, 400.7 eV に 3 つのシャープなピーク a, b, c が, hv=407 eV にブロードなピーク d が観測された。こ れらのピークはアークジェット法¹⁸⁾やマグネトロンスパ ッタリング¹⁹⁾により合成された CN_x 薄膜の NEXAFS ス ペクトルにも観測されており、XPS と同様他の合成方法 においても存在するユニバーサルな局所構造に起因したも のである。しかしその解釈については XPS 以上に不明な 点が多く,ほとんどわかっていない。これは NEXAFS が 内殻準位の化学シフトという始状態効果だけでなく、内殻 正孔ポテンシャルの効果などの終状態効果によっても影響 を受けるため、その解釈が単純ではないことによる²⁰⁾。 ところが興味深いことに我々の試料の NEXAFS スペクト ルは明瞭な偏光依存性を示した。この結果はイオン注入の 出発物質として用いた HOPG がそろった配向を持つこと によると考えられる。よってこれを手がかりに各ピークの 帰属について以下考察しよう。

スペクトル中のシャープなピーク a, b, c は斜入射にな るにつれ強度が大きくなり,直入射で小さくなる偏光依存 性を示した。一方ピーク d はこれとは逆の傾向を示す。 また,スペクトル形状は600~700 ℃付近のアニールによ り変化し始め,840 ℃でアニールした試料では,NEXAFS スペクトルの偏光依存性はさらにはっきり観測されるよう になった(Fig.3(b))。Figure 4 のロ, \triangle , \bigcirc のプロッ トは放射光の偏光方向と試料の法線方向とのなす角に対す るピーク a, b, c のそれぞれの強度をあらわす。Figure 4 (a)に示すようにアニール前の試料ではピーク a, b, c の偏 光依存性は似た傾向を示した。一方,アニール後(Fig.4



Figure 3. (a) N 1s NEXAFS spectra of CN_x film prepared by 3 keV nitrogen ion implantation at the N₂⁺ fluence of 1.7×10^{15} ions/ cm² without annealing. From the bottom to top, curves show the results from grazing incidence to normal incidence. (b) The same as Fig. 3(a) for the CN_x film after annealing at 840°C for 3 minutes.



Figure 4. (a) Polarization dependence of the intensities of the π^* resonances in the N 1s NEXAFS spectra before annealing. Marks \Box , \triangle , and \bigcirc show the normalized peak intensity ratios of the peaks a, b, and c in the N 1s NEXAFS spectra of Fig. 3(a). Solid lines show the best fit results of theory and broken lines show the reference curves for various polar angles α and γ . (b) The same as Fig. 4 (a) for the N 1s NEXAFS spectra after 840°C annealing procedure.

(b))はピーク a, c が同じ傾向を強めるのに対しピーク b は僅かながら逆向きの偏光依存性を示した²¹⁾。これらの ピークの帰属を考える前に NEXAFS の偏光依存性につい て簡単に説明する。軽元素の NEXAFS ピーク強度 *I* は 1 s 軌道から空軌道への双極子遷移によって表される²²⁾。

$$I \propto |\langle f | \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{p} | i \rangle|^{2}$$

= | \boldsymbol{E} \cdot \langle f | \boldsymbol{p} | i \rangle|^{2} (1)

ここでEはX線の電場ベクトル,pは電子の運動量演 算子, $|i\rangle$ は1s始状態, $\langle f |$ は終状態を表す。行列要素 $\langle f | p | i \rangle$ は遷移先の軌道ベクトルOの方向を示すため,EとOが大きい射影をなすとき遷移強度Iは強められる。 つまり,

 $I \propto \cos^2 \delta$ (2)

ここで δ はEとOのなす角である。 π *空軌道と σ *空 軌道は互いに直交しているため, NEXAFS スペクトルに おいて π^* ピークと σ^* ピークは互いに逆の偏光依存性を示 す。例えば(0001)面が表面の HOPG の場合, *π**の軌道べ クトルが表面法線方向を向いているためC1sNEXAFS において π^* ピークは斜入射で強められ、 σ^* ピークは逆に 直入射で強められる²³⁾。このことより Fig. 3の NEXAFS スペクトルにおいても π^* と σ^* ピークが存在していること は明らかである。また, Plashkevych ら²⁴⁾による様々な CN_xのNEXAFS 理論計算によれば,405 eV 付近より高 エネルギー側で現われる σ^* ピークに対し, π^* ピークはそ れよりも低いエネルギー領域に位置することが報告されて いる。以上の結果から**Fig.3**のピークa, b, cは1s→ π^* , ピークdは1s→ σ^* 遷移に帰属される。この結果から この薄膜中に C-Nπ 結合を持つ(π 共役系の)局所構造が 存在するということがわかった。ここで注目すべきことは、 π 共役系は π 結合と共に σ 結合も持つため, π 共役系の局 所構造に起因した NEXAFS には互いに逆の偏光依存性を 示す π^* ピークと σ^* ピークが存在するということである。 一方、ダイヤモンド構造のように立体的に等価な sb^3 の σ 結合に起因した σ*ピークは入射角に依存せずほぼ一定の ピーク強度を示す。**Figure 3** において σ^* ピークは明瞭な 偏光依存性を示し、斜入射でその強度は非常に抑制された。 NEXAFS のこのエネルギー領域には偏光依存性を持たな い連続帯が存在することを考慮すると、この結果は CN_x 薄膜中で sp³立体配置をとる N があまり存在していない ことを示唆している。

次に π 結合を持つ N の局所構造を考えてみよう。この CN_x 薄膜の低い窒素濃度($[N]/[C] \le 5\%$)から大多数の 窒素は炭素のみと結合していると考えられるので, N の 局所構造としては **Fig. 5**に示すように(a) 3 重結合, (b) 2 重結合, (c)単結合による 3 つの系が挙げられる。しか しこれらの構造が 3 つのピークのどれかに対応すると簡 単に結論づけることはできない。というのはピーク a, b, c が同じ π 共役系の局所構造に起因したものである可能性 もあるからである。例えばベンゼンの C 1s NEXAFS ス ペクトルには $\pi^*(e_{2u}) \ge \pi^*(b_{2g}) \ge いう二つの \pi^*ピーク$ が存在し,これは同じ構造による異なる軌道成分であ る²⁵⁾。しかし、上記の局所構造のうち、同じ構造に起因 する π^* ピークであればその偏光依存性は同じ傾向を示す はずなので、アニール後互いに異なる偏光依存性を示した



Figure 5. Possible configurations of nitrogen local structures in carbon network with one, two, or three neighbors.

ピーク a, c とピーク b はそれぞれ異なる局所構造に起因 していると言える。ところでグラファイトの結晶構造を ベースにしたときこれらの局所構造中で(b)はピリジン構 造として, また(c)はグラファイト構造としてグラファイ トシート (グラフェン)内に入ってグラファイトと同じ配 向をとりうるが, (a)のシアン構造だけはグラフェン面内 に入り得ないためその両者とは異なった配向を持つであろ う。この結果はピーク b がシアン構造に起因する π^* ピー クであることを強く支持する。

一方でピーク a, c はどちらも似た偏光依存性を示す が,この二つは同じ局所構造に起因したものなのだろう か? この問題を取り扱うためにも,各ピークの偏光依存 性についてもう少し定量的に議論しよう。π*軌道にはベ クトル型と平面型の2種類があり,それぞれの偏光依存 性の理論式は次の(3),(4)式のように表される²²⁾。

$$I(\theta) = A \left\{ \frac{P}{3} \left[1 + \frac{1}{2} (3\cos^2 \theta - 1) (3\cos^2 \alpha - 1) \right] + \frac{(1-P)}{2} \sin^2 \alpha \right\}$$
(3)

$$I(\theta) = B \left\{ \frac{2P}{3} \left[1 - \frac{1}{4} (3\cos^2 \theta - 1) (3\cos^2 \gamma - 1) \right] + \frac{(1-P)}{2} (\cos^2 \gamma + 1) \right\}$$
(4)

ここで*A*, *B*は入射角積分した吸収断面積であり, *P*は偏 光度(=0.95), α はベクトル型の π *軌道ベクトル*O*と試 料法線とのなす角度, γ は平面型の π *軌道の法線ベクト ル*N*と試料法線とのなす角度である。Figure 6(a), (b) にそれぞれの角度の関係を示す。ピリジン構造とグラファ イト構造の π *軌道はベクトル型であり, 3 重結合のシア ン構造は平面型の π *軌道を持つため, ピークa, cには式 (3)が, ピークbには式(4)が適用できる。我々は(3), (4) 式をそれぞれのデータに対し最小二乗法でフィッティング してそれぞれの π *軌道の α と γ を求めた。Figure 4 にそ



Figure 6. (a) Coordination system defining of a π^* vector orbital on the surface. The polar angle α is defined as an angle between the π^* orbital vector *O* and surface normal *z*. The electric field vector of synchrotron radiation is divided into horizontal component $E^{//}$ and vertical component E^{\perp} , and the polarization factor *P* is defined as $P \equiv |E^{//}|^2/(E^{//}|^2 + E^{\perp}|^2)$. The incidence angle θ is defined as an angle between $E^{//}$ and surface normal, and δ is defined as an angle between *O* and $E^{//}$. (b). The same as Fig. 6(a) for π^* plane orbital on the surface. The polar angle γ is defined as an angle between the π^* plane normal *N* and surface normal *z*.

の最終的な理論曲線(実線)と様々な配向を想定した理論 曲線(破線)を示す。その結果,アニール前にはピーク a に対し $\alpha = 46^{\circ} \pm 5^{\circ}$, ピークcに対し $\alpha = 40 \pm 5^{\circ}$, ピークb に対し γ=85±15°の値を得た。アニール後これらの値は 変化し、ピークaに対し $\alpha=34\pm5^\circ$ 、ピークcに対し $\alpha=$ $30\pm5^\circ$, ピークbに対し $\gamma=44\pm5^\circ$ の値を得た。アニール の前後でピーク a, c の α 値が減少しているのはイオン照 射によるグラファイト結晶の損傷が次第に回復しているこ とを意味していると考えられる。一方,ピーク b のγ値 は大きく変化し,アニール後シアン構造がグラファイト面 に対し斜めに立った配向をもつことことがわかった。ま た, ピーク a, c の比較において注目すべきことはアニー ルの前後においてピーク a, c がわずかに異なる偏光依存 性を示していることである。この結果は両者がそれぞれ異 なる配向を持った軌道成分であることを意味している。さ らに決定的なのはアニールによる変化である。Figure 7 に840°C(Fig. 7(a))と1100°C(Fig. 7(b))の異なる温 度でアニールした試料のN 1s NEXAFS スペクトルを示 す。実線は斜入射 (θ =10°), 破線は直入射 (θ =90°) の データを表す。840℃のときと比べ1100℃の高温でアニー ルしたときのほうがピーク a, c 共にグラファイト的な偏 光依存性がさらに強められており、イオン照射による損傷 が回復し結晶の配向が良くなっていることがわかるが、よ り注目すべきはピークaにたいするピークcの強度比が大 きくなっていることである。仮にピークaとcが同じ局所 構造に起因した π*ピークであるならばアニールにより配 向が変化したとしてもその相対比は変化しないはずなの で,これら結果よりピーク a と c も異なる局所構造に起因 したものであると結論できる。

厳密には NEXAFS ピーク強度比の変化は、それぞれの



Figure 7. N 1s NEXAFS spectra of CN_x films after (A) 840°C and (B) 1100°C annealing for 3 minutes. Solid and dotted lines show the spectra for grazing $(\theta=10^\circ)$ and normal $(\theta=90^\circ)$ incidence, respectively.

ピークに対応する局所構造の①組成比と②配向の変化両方 の影響によるものなので、ここからすぐにピークcに対応 する局所構造の組成比が、より高温のアニールにより大き くなっていると結論することはできない。しかし、入射角 度をうまく設定してやれば配向による影響を排除すること ができる。Figure 4 からわかるように θ =55°付近で系の 配向によらずピーク強度が交差する点が存在する。これは 魔法角(magic angle)として知られているもので、正確 には θ =54.7°においてランダム配向と同じ状況での相対 的なピーク強度が観測される²²⁾。このため魔法角での ピーク強度を求めることにより偏光依存性による影響を除 外した比較を行うことが出来る。そこで我々は Fig. 7 の ピーク a とピーク c の両方のピークについて、 θ =10°と 90°のそれぞれスペクトルにおけるピーク強度の平均値 *I_{Ae}*を求め、さらにこの平均値の比を求めた。つまり、

$$I_{Av.}^{\text{peak}}(T) = \frac{I_{10} + I_{90}}{2}$$
(7)

$$\frac{I_{Av.}^{\text{peak a}}(840)}{I_{Av.}^{\text{peak c}}(840)} \approx 0.54$$

$$\frac{I_{Av.}^{\text{peak a}}(1100)}{I_{Av.}^{\text{peak c}}(1100)} \approx 0.36$$
(8)

ここで *I*^{peat} はアニール温度 *T*における各ピークのピーク 強度平均値である。この結果より明らかにピーク c に対応 する局所構造の比率が1100℃のアニールによって増して いることがわかった。アニールによりグラファイトの結晶 構造が回復したことを考慮すると、ピリジン構造は次第に グラファイト構造に変化していくと考えられるのでピーク a はピリジン構造, そしてピーク c はグラファイト構造に



Figure 8. Schematic diagrams of CN_x local structures in graphite matrix. Dark balls and white balls show graphite and nitrogen atoms, respectively. a: pyridinelike structure b: cyanic structure c: graphitelike structure.

起因した π^* ピークであると帰属される²⁶⁾。Plashkevych ら²¹⁾ の STEX 理論計算によれば, CN_x 化合物の N1s NEXAFS においてピリジン構造の π^* ピークが最も低いエ ネルギーに現われ,次にシアン構造の π^* ピーク,グラフ ァイト構造のように炭素が3配位した N による π^* ピーク が最も高エネルギー側に現われる。この結果は我々の解釈 を支持している。

以上の結果から CN_x 薄膜中の構造を眺めてみることに しよう。Figure 8 の模式図に示したように, ピリジン構 造とグラファイト構造はグラフェン面内に入ってグラファ イトと同じ配向をとり,シアン構造はグラフェンと C-C 単結合で結合するため特定の方向を向くことができず,グ ラファイトの層間で様々な方位角をもって(つまりランダ ムな配向で)存在していると考えられる。このためシアン 構造に対応するピークbはあまり大きな偏光依存性を示 さないのだろう。また,ピリジン構造のNのサイトでは グラファイトネットワークが途切れているため,グラファ イト構造に比べ若干自由度が存在する。これがピリジン構 造とグラファイト構造のα値の僅かな違いとなって表れ ていると解釈することができる。

4. まとめ

CN_x薄膜はその合成方法や合成に関する様々なパラ メータによりその組成・構造を大きく変える。よって合成 条件探索のためには XPS スペクトルや NEXAFS スペク トルに観測されるピークが何に帰属されるのかという分光 学的な基礎研究が非常に重要なのは言うまでも無い。 XPS ではなかなか明らかにできなかったこの問題に対 し,我々は NEXAFS スペクトルの偏光依存性から,薄膜 中にピリジン構造,シアン構造,グラファイト構造の3 つの局所構造が存在することを明らかにした。以上一例で はあるが, CN_xのような新物質の構造解析に対する NEX-AFS 分光法の有用性を示した。近年,物性研究において 新物質創製は一つの大きなキーワードとなってきている が,この面からも NEXAFS を用いた研究はますます増え ていくことだろう。今後, CN_x ばかりでなくさらに新奇 な物質の構造解析にこの手法を用いて展開していきたいと 考えている。

5. 謝辞

本稿で紹介した内容は KEK-PF の共同利用実験課題番 号99G247の研究テーマとして、日本原子力研究所の表面 化学研究グループの馬場祐治グループリーダー、関口哲弘 研究員、また中国科学技術大学の Wu Guohua 博士との共 同研究により行われた。また BL-11A の北島義典博士, また BL-27A の小林克巳助教授をはじめ PF のスタッフ および原研スタッフの方々に感謝いたします。

参考文献

- 1) 野尻抱介:ふわふわの泉(ファミ通文庫, 2001).
- 2) A. Y. Liu and M. L. Cohen: Science 245, 841 (1989).
- 3) D. M. Teter and R. J. Hemley: Science 271, 53 (1996).
- 4) A. Y. Liu and M. L. Cohen: Phys. Rev. B 41, 10727 (1990).
- 5) A. Snis and S. F. Mater: Phys. Rev. B 60, 10855 (1999).
- 6) M. C. Santos and F. Alvalez: Phys. Rev. **B** 58, 13918 (1998).
- 7) M. Côté and M. L. Cohen: Phys. Rev. B 55, 5684 (1997).
- H. Sjöström, S. Stafström, M. Boman and J.-E. Sundgren: Phys. Rev. Lett. 75, 1336 (1995).
- D. Marton, K. J. Boyd, A. H. Al-Bayati, S. S. Todorov and J. W. Rabalais: Phys. Rev. Lett. 73, 118 (1994).
- H. Sjöström, I. Ivanov, M. Johansson, L. Hultman, J.-E, Sundgren, S. V. Hainsworth, T. F. Page and L. R. Wallenberg: Thin Solid Films 246, 103 (1994).
- 11) N. Chunming, Y. Z. Lu and C. M. Lieber: Science **261**, 334 (1993).
- 12) Y. Tani, Y. Aoi and E. Kamijo: Appl. Phys. Lett. 73, 1652 (1998).
- 13) K. Yamamoto, Y. Koga, K. Yase, S. Fujikawa and M. Kubota: Jpn. J. Appl. Phys. 36, Pt. 2, L230 (1997).
- 14) 徳高,石原,西守,岸田,高淵:表面科学 11,48 (1990).
- 15) A. Mansour and D. Ugolini: Phys. Rev. B 47 (1993) 10201.
- 16) K. Siegbahn, C. Nordling, A. Fahlman, R. Nordberg, K. Hamrin, J. Hedman, G. Johansson, T. Bergmark, S. E. Karlsson, I. Lindgren and B. Lindberg: ESCA-Atomic, Molecular, and Solid State Structure Studies by Means of Electron Spectroscopy, Nova Acta Regiae Soc. Sci., Ups. 4 (1967) 20.
- I. Shimoyama, T. Sekiguchi and Y. Baba: Jpn. J. Appl. Phys.
 39, Pt. 1, 4541 (2000).
- 18) I Jimenez, W. M. Tong, D. K. Shuh, B. C. Holloway, M. A. Kelly, P. Pianetta, L. J. Terminello and F. J. Himpsel: Appl. Phys. Lett. 74, 2620 (1999).
- J.-H. Guo, W. T. Zheng, C. Sathe, N. Hellgren, A. Agui and J.-E. Sundgren: J. Elect. Spectrosc. Relat. Phenom. 101– 103, 551 (1999).
- 20) H. Oji, R. Mitsumoto, E. Ito, H. Ishii, Y. Ouchi, K. Seki, T. Yokoyama, T. Ohta and N. Kosugi: J. Chem. Phys. 109, 10409 (1998).
- 21) I. Shimoyama, G. Wu, T. Sekiguchi and Y. Baba: Phys. Rev. B 62, R6053 (2000).
- 22) J. Stöhr: NEXAFS Spectroscopy, (Springer, Berlin, 1996).
- 23) R. A. Rosenberg, P. J. Love and V. Rehn: Phys. Rev. B 33, 4034 (1986).
- 24) O. Plashkevych, A, Snis, L. Yang, H. Ågren and F. Mater: Phys. Scr. 63, 70 (2001).

ーロメモ -

- 25) J. L. Solomon, R. J. Madix and J. Stöhr, Surf. Sci. 255, 12 (1991).
- 26) I. Shimoyama, G. Wu, T. Sekiguchi and Y. Baba:J. Elect. Spectrosc. Relat. Phenom. 114–116, 841 (2001).
- 27) W. T. Zheng, K. Z. Xing, N. Hellgren, M. Lögdlund, Å. Johansson, U. Gelivs, W. R. Salaneck and J.-E. Sundgren: J. Elect. Spectrosc. Relat. Phenom. 87, 45 (1997).
- D. Marton, K. J. Boyd, A. H. Al-Bayati, S. S. Todorov and J. W. Rabalais: Phys. Rev. Lett. 73, 118 (1994).
- 29) C. Ronning, H. Feldermann, R. Merk, H. Hosfsass, P.

Reinke and J.-U. Thiele: Phys. Rev. B 58, 2207 (1998).

- 30) B. C. Holloway, O. Kraft, D. K. Shuh, M. A. Kelly, W. D. Pianetta and S. Hagstrom: Appl. Phys. Lett. 74, 3290 (1999).
- 31) L. Galan, I. Montero and F. Rueda: Surf. Coat. Technol. 83, 103 (1996).
- 32) C. Quiros, J. G. Garcia, F. J. Palomares, L. Soriano, E. Elizalde and J. M. Sanz: Appl. Phys. Lett. 77, 803 (2000).
- 33) J. H. Kim, D. H. Ahn, Y. H. Kim and H. K. Baik: J. Appl. Phys. 82(2), 658 (1997).

アオキ

ミズキ科アオキ属の常緑性低木で,葉は厚くつやがあり, 長さ8~20 cm,幅2~10 cmで荒い鋸葉がある。日陰でも よく生長するので,庭木や公園樹として利用される。花は晩 春に紫褐色に咲き,実は冬に赤色となる。生葉はあぶって泥 状とし,やけどやきり傷に塗ったり,そのエキスは凍傷など に効果があると言われている。また,動物とのかかわりは深 く,枝や葉はカモシカが,実はヒヨドリをはじめとする鳥が 好んで食べる。そのため,種子が各地に運ばれ,身近な場所 で見られる。

暗いニュースが多い昨今ですが、白川先生、野依先生と2 年連続のノーベル化学賞受賞は明るいニュースで、若者に科 学の楽しさ・面白さを伝えるのに多いに役に立っています。 (No. 43, K. Ohshima)

